

(11)Publication number :

05-230161

(43)Date of publication of application: 07.09.1993

(51)Int.CI.

CO8F299/08 CO9D175/04

(21)Application number: 04-069500

(71)Applicant : SHIN ETSU CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

18.02.1992

(72)Inventor: ONO ICHIROU

(54) GRAFT COPOLYMER AND COATING COMPOSITION USING THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject copolymer, composed of a backbone polymer composed of a vinylic polymer and a branch polymer prepared by grafting an organopolysiloxane, etc., onto the backbone polymer, excellent in weather resistance, water repellence, anti-fouling and mold release properties and lubricity and useful as coatings, etc.

CONSTITUTION: The objective copolymer is composed of (A) a backbone polymer composed of a vinylic polymer such as (meth)acrylic acid and (B) a branch polymer, composed of an organopolysiloxane and a branch polymer, composed of a polyoxyalkylene and grafted onto the backbone polymer. Furthermore, a coating composition consisting essentially of the copolymer is obtained. This copolymer is obtained by copolymerizing, e.g. a compound of formula I [R1 is H or methyl; R2 is 1–11C bifunctional hydrocarbon; (m) is 0–2; (n) is 0–200] with a compound of formula II [R3 is R1; R4 is H, 1–4C monovalent hydrocarbon or acetyl; (i) is 2≤(i)<3; j is 2–50].

[Date of request for examination]

29.08.1994

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2611893

[Date of registration]

27.02.1997

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of extinction of right]





Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-230161

(43)公開日 平成5年(1993)9月7日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 8 F 299/08

MRY

7442-4 J

C 0 9 D 175/04

PHR

8620-4 J

審査請求 未請求 請求項の数3(全 13 頁)

(21)出願番号

特願平4-69500

(22)出願日

平成4年(1992)2月18日

(71)出願人 000002060

信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

(72)発明者 小野 猪智郎

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料

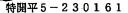
技術研究所内

(74)代理人 弁理士 岩見谷 周志

(54) 【発明の名称】 グラフト共重合体及びそれを用いた被覆組成物

(57) 【要約】

【構成】 ビニル系重合体からなる幹ポリマーと、該幹ポリマーにグラフトされたオルガノポリシロキサンからなる枝ポリマー及びポリオキシアルキレンからなる枝ポリマーとからなるグラフト共重合体及び該グラフト共重合体を主成分とする被覆組成物。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ビニル系重合体からなる幹ポリマーと、 眩幹ポリマーにグラフトされたオルガノポリシロキサン からなる枝ポリマー及びポリオキシアルキレンからなる 枝ポリマーとからなるグラフト共重合体。

1

【請求項2】 請求項1に記載のグラフト共重合体を主 成分とする被覆組成物。

【請求項3】 幹ポリマーがラジカル重合性ヒドロキシ アルキルエステル類に由来する構成単位からなる請求項 1に記載のグラフト共重合体を主成分とする、請求項2 10 に記載の被覆組成物であって、さらに多官能イソシアネ ート化合物を含有してなる被覆組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ビニル系重合体からな る幹ポリマーにオルガノポリシロキサンからなる、枝ポ リマー及びポリオキシアルキレンからなる枝ポリマーが グラフトされているグラフト共重合体、及び該グラフト 共重合体を主成分とする被覆組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】ラジカル重合性基含有シリコーンマクロ マーを使用したシリコーン系グラフト共重合体は、耐候 性、撥水性、防汚性、離型性、潤滑性に優れていること から、被覆材料として大きな関心が持たれている(特開 昭58-154766号、特開昭59-20360 号、特開昭59-1264 78号、特開昭61-151272号、特開昭62-156172号)。然 しながら、従来のシリコーン系グラフト共重合体は、い ずれも幹ポリマーがビニル系重合体、枝ポリマーがオル ガノポリシロキサンのグラフト共重合体であり、これを 主成分とする被覆材料は、帯電防止性能に劣るという欠*30

*点がある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は、耐候性、撥水性、防汚性、離型性、潤滑性に優れる だけでなく、帯電防止性能にも優れたシリコーン系グラ フト共重合体及び該共重合体を使用する被覆組成物を提 供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は、ビニル系重合体からなる幹ポリマーと、 該ポリマーにグラフトされたオルガノポリシロキサンか らなる、枝ポリマー及びポリオキシアルキレンからなる 枝ポリマーとからなるグラフト共重合体、及び該グラフ ト共重合体を主成分とする被覆組成物を提供するもので ある。

【0005】グラフト共重合体

本発明のグラフト共重合体は、ビニル系重合体からなる 幹ポリマーにグラフトされた枝ポリマーとして、オルガ ノポリシロキサンからなる枝ポリマーとポリオキシアル 20 キレンからなる枝ポリマーを有する。上記オルガノポリ シロキサンとしては、例えば、ジメチルポリシロキサ ン、炭素原子数2~10のジアルキルポリシロキサン、メ チルフェニルポリシロキサン、ジフェニルポリシロキサ ン、メチルトリクロロプロビルポリシロキサン等が挙げ られ、この中で、ジメチルポリシロキサンが好ましい。

【0006】本発明のグラフト共重合体において、この オルガノポリシロキサンからなる枝ポリマーを含む単位 を構成単位(a) として、構成単位(a) を具体的に表す と、例えば、

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
R^{1} \\
+ CH_{2}C + \\
C - OR^{2}Si(CH_{3})_{m} \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_{3} & CH_{3} \\
| OSi + n & OSi - CH_{3} \\
CH_{3} & CH_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_{3} & CH_{3} \\
| OSi + CH_{3} & CH_{3}
\end{array}$$

40

(式中、R1 は水素原子又はメチル基、R2 は酸素原子 で中断されていてもよい炭素原子数1~11の2価の炭化 水素基、mは 0.1又は2、nは平均重合度を表す0~20 0 の数である。) で表される。

【0007】上記のポリオキシアルキレンとしては、例 えば、エチレンオキサイド重合体、エチレンオキサイド とプロピレンオキサイドの共重合体等が挙げられる。本 発明のグラフト共重合体において、このポリオキシアル キレンからなる枝ポリマーを含む単位を構成単位(b)と して、この構成単位(b) を具体的に表すと、例えば、

(式中、R3 は水素原子又はメチル基、R1 は水素原 子、炭素原子数1~4の1価の炭化水案基又はアセチル 基、iは2≦i<3の数、jは平均重合度を表す2~50 の数である。)で表される。

 $C-0 + C_1 H_{21} O + R^4$

Rз

 $+ CH_2C+$

【0008】更に、枝ポリマーを含まない単位を構成単 位(c) とすると、構成単位(c) は、ラジカル重合性モノ マーを共重合したものである。そのラジカル重合性モノ 50 マーとしては、例えば、アクリル酸又はメタクリル酸

【化2】

---554---

特開平5-230161

(以下 (メタ) アクリル酸という); (メタ) アクリル 酸メチル、(メタ)アクリル酸プチル、(メタ)アクリ **ル酸-2-エチルヘキシル等のアルキルエステル類、** (メタ) アクリル酸ヒドロキシエチル、(メタ) アクリ ル酸ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸ヒドロキ シプチル等のヒドロキシアルキルエステル類、アクリル アミド等の酸アミド類、(メタ)アクリル酸パーフロロ デシルエチル、(メタ)アクリル酸パーフロロオクチル エチル、(メタ) アクリル酸パーフロロヘキシルエチ ル、(メタ) アクリル酸パーフロロプチルエチル等パー 10 フロロエステル類等の(メタ)アクリル酸の各種誘導 体;スチレン又はスチレン誘導体;フマル酸、マレイン 酸又はこれらの誘導体;ピニルトリメトキシシラン、ア - メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン等のラジ カル重合性珪素化合物; アクリロニトリル、ピニルピロ

3

【0009】本発明のグラフト共重合体において、上記 20 ラジカル重合性モノマーの中の(メタ)アクリル酸ヒド ロキシエチル、(メタ)アクリル酸ヒドロキシプロピ ル、(メタ) アクリル酸ヒドロキシブチル等のヒドロキ シアルキルエステル類の共重合体を含有する場合、この グラフト共重合体を被覆組成物に使用する際に、架橋剤 として多官能イソシアネート化合物を配合すると、耐溶*

リドン、酢酸ビニル、ビニルアルキルエーテル等が挙げ

られる。これらのラジカル重合性モノマーは、単独で用

いることも二種以上を組み合わせて用いることもでき

る.

*剤性も向上させることができる。これについての詳細は 後述する。

【0010】本発明のグラフト共重合体は、構成単位 (c) が含まれずに、構成単位(a) 及び構成単位(c) から 構成されてもよい。本発明のグラフト共重合体中の構成 単位(a) 及び (b)の比率は (a)、 (b)及び他のラジカル 重合性モノマーの種類によって異なり、一概には言えな いが、一般的には (a)が5~60重量%、 (b)は2~50重 量%、好ましくは (a)が10~50重量%、 (b)は5~30重 量%である。(a)が少なすぎると、耐候性、撥水性、防 汚性、離型性、潤滑性が不十分である一方、多すぎると 造膜性が不十分となる。また、 (b) が少なすぎると帯電 防止性が不十分であり、多すぎると接水性、離型性、潤 滑性が不十分となる。

【0011】グラフト共重合体の製造

本発明のグラフト共重合体は、ラジカル重合性基含有オ ルガノポリシロキサン化合物とラジカル重合性基合有ポ リオキシアルキレン化合物及びこれらと共重合可能な前 記のラジカル重合性モノマーを所定量配合して共重合す ることにより得られる。ラジカル重合性基含有オルガノ ポリシロキサン化合物のラジカル重合性基としては、例 えば、アクリル基;メタクリル基;ピニル基;アリル基 等のアルケニル基;スチリル基等が挙げられる。ラジカ ル重合性基含有オルガノポリシロキサン化合物として は、好ましくは、一般式(A);

【化3】

$$\begin{array}{c}
R^{1} \\
CH_{2} = C \\
C \\
C - OR^{2}Si(CH_{3})_{m} \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
CH_{3} \\
CH_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
CH_{3} \\
CH_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
CH_{3} \\
CH_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
CH_{3}
\end{array}$$

(式中、R¹、R²、m及びnは前記のとおりであ る。) で表される化合物である。

[0012] 一般式(A) で表される化合物は、例えば、 一般式(B);

(化4) $CH_2 = C - C - OR^2 Si(CH_3)_m Cl_{(8-m)}$ (B) Ö CH₃

(式中、nは前記のとおりである。) で表される末端水 配基置換ジメチルポリシロキサンとを、常法に従い脱塩 酸反応させることにより得ることができる。上記一般式 50

※(式中、R¹、R²及びmは前記のとおりである。)で 表されるアクリレート又はメタクリレート置換クロロシ ラン化合物と、一般式(C); 【化5】

(A) で表される化合物の具体例としては、例えば以下に 示すものが挙げられる。

【化6】

(C)

特開平5-230161

 $CH_{2} = \frac{CH_{3}}{CCO(CH_{2})_{3}Si(CH_{3})_{2}} + \frac{CH_{3}}{OSi} + \frac{CH_{3}}{OSi - CH_{3}}$

$$CH_{2} = \frac{CH_{3}}{CCO(CH_{2})_{3}Si(CH_{3})_{2}} = \begin{bmatrix} CH_{3} \\ I \\ OSi \\ I \\ CH_{3} \end{bmatrix} = \frac{CH_{3}}{OSi - CH_{3}}$$

$$CH_{2} = \begin{array}{c} CH_{3} \\ I \\ CCO(CH_{2})_{3}Si(CH_{3})_{2} \end{array} \left[\begin{array}{c} CH_{3} \\ I \\ OSi \\ CH_{3} \end{array} \right]_{25} \begin{array}{c} CH_{3} \\ I \\ CH_{3} \end{array}$$

$$CH_{2} = \begin{array}{c} CH_{3} \\ CCO(CH_{2})_{3}Si(CH_{5})_{2} \\ \parallel \\ 0 \end{array} \qquad \begin{array}{c} CH_{3} \\ OSi \\ -CH_{3} \end{array} \qquad \begin{array}{c} CH_{3} \\ \parallel \\ Si - CH_{3} \end{array}$$

$$CH_{2} = \begin{array}{c} CH_{3} \\ CCO(CH_{2})_{3}Si(CH_{3})_{2} \\ 0 \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ OSi \\ CH_{3} \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ I \\ OSi - CH_{3} \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 = \begin{array}{c} \text{CCO(CH}_2)_3 \text{Si(CH}_3)_2 \\ \text{0} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{0} \\ \text{CH}_3 \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{0} \\ \text{CH}_3 \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{OSi} \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

$$CH_{2} = CH - CO(CH_{2})_{3}Si(CH_{3})_{2} = \begin{bmatrix} CH_{3} \\ I \\ OSi \\ I \\ CH_{3} \end{bmatrix}_{25} = CH_{3}$$

【化7】

特開平5-230161

10

 $CH_{2} = CHCO(CH_{2})_{3}Si(CH_{3}) = \begin{bmatrix} CH_{3} & CH_{3} \\ I & CH_{3} \\ CH_{3} & CH_{3} \end{bmatrix}$ $CH_{3} = CHCO(CH_{2})_{3}Si(CH_{3}) = \begin{bmatrix} CH_{3} & CH_{3} \\ I & CH_{3} \\ CH_{3} & CH_{3} \end{bmatrix}$

(6)

$$CH_2 = CHCO(CH_2)_3Si(CH_3) \begin{bmatrix} CH_3 & CH_3 \\ | & | \\ OSi + 50 \end{bmatrix} = OSiCH_3$$

$$CH_3 = CHCO(CH_2)_3Si(CH_3) \begin{bmatrix} CH_3 & CH_3 \\ | & | \\ CH_3 & CH_3 \end{bmatrix}$$

$$CH_{2} = CHCO(CH_{2})_{2}O(CH_{2})_{3}Si(CH_{3}) - \begin{bmatrix} CH_{3} & CH_{3} \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & | \\ | & |$$

$$CH_2 = \begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CCOCH_2Si(CH_3) \\ | \\ O \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3 \\ | \\ CH_3 \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ OSiCH_3 \\ | \\ CH_3 \end{array} \end{array}$$

$$CH_2 = \begin{array}{c} CH_3 \\ CCO(CH_2)_3Si \end{array} \left[\begin{array}{c} CH_3 \\ I\\ OSi \\ CH_3 \end{array} \right] \begin{array}{c} CH_3 \\ I\\ CH_3 \end{array} \right]_3$$

$$CH_{2} = \begin{array}{c} CH_{3} \\ CCO(CH_{2})_{3}Si \end{array} \begin{bmatrix} CH_{3} \\ OSi + 25 \\ CH_{3} \end{bmatrix} - \begin{array}{c} CH_{3} \\ OSiCH_{3} \\ CH_{3} \end{bmatrix}_{3}$$

$$CH_{z} = CHCO(CH_{z})_{3}Si - \begin{bmatrix} CH_{3} & CH_{3} \\ | & | \\ CH_{3} & CH_{3} \end{bmatrix}_{3}$$

(化9]

(7)



12

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_3 \\
\text{CH}_2 = \begin{array}{c}
\text{CH}_3 \\
\text{COCH}_2 \text{Si} \\
\text{O}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_3 \\
\text{OSi} \rightarrow 25 \\
\text{CH}_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_3 \\
\text{OSiCH}_3 \\
\text{CH}_3
\end{array}$$

$$CH_{2} = \frac{CH_{3}}{CCO(CH_{2})_{2}O(CH_{2})_{3}Si} = \frac{CH_{3}}{\begin{pmatrix} CH_{3} & CH_{3} \\ | & | \\ CH_{3} & CH_{3} \end{pmatrix}} = \frac{CH_{3}}{\begin{pmatrix} CH_{3} & CH_{3} \\ | & | \\ CH_{3} & CH_{3} \end{pmatrix}$$

$$CH_{2} = CCO(CH_{2})_{11}Si - \begin{bmatrix} CH_{3} & CH_{3} \\ I & I \\ OSI + 25 & OSICH_{3} \\ I & CH_{3} & CH_{3} \end{bmatrix}_{2}$$

$$CH_2 = CHCO(CH_2)_3Si - \begin{bmatrix} CH_8 & CH_3 \\ I & I \\ OSi \rightarrow 100 & OSiCH_8 \\ I & CH_3 & CH_3 \end{bmatrix}$$

[0013] ラジカル重合性基含有ポリオキシアルキレン化合物のラジカル重合性基としては、例えば、アクリル基;メタクリル基;ビニル基;アリル基等のアルケニル基;スチリル基等が挙げられる。ラジカル重合性基含有ポリオキシアルキレン化合物としては、好ましくは、

一般式(D);

[(£10]

$$R^{3}$$

 $CH_{2} = C$
 $C = C$

(式中、R³、R¹、i及びjは前記のとおりである。)で表される化合物である。上記一般式(D)で表される化合物の具体例としては、例えば以下に示すものが挙げられる。

【化11】

40

30

(8)

10



特開平5-230161

$$CH_{3} = C - C - O(C_{2}H_{4}O)_{2}H_{0}$$

$$O(C_{2}H_{4}O)_{2}H_{0}$$

$$CH_2 = CH - C - O(C_2H_4O)_2H$$
0

$$CH_{2} = \begin{array}{c} CH_{3} \\ I \\ CH_{2} = C - C - O(C_{2}H_{1}O)_{8}H \\ II \\ O \end{array}$$

$$CH_{2} = \overset{CH_{3}}{\overset{|}{C} - C - O(C_{2}H_{4}O)_{8}CH_{3}}$$

$$CH_{2} = \begin{array}{c} CH_{3} \\ I \\ C-C-CC_{2.5} \\ II \\ O \end{array}$$

$$CH_{2} = \begin{matrix} CH_{3} \\ I \\ C - C - O(C_{2}, & H_{5}O) & OCCH_{3} \\ || & || & || \\ O & O \end{matrix}$$

$$CH_2 = CH - C - O(C_2H_4O)_{20}C_4H_9$$

【化12】

$$CH_{2} = C - C - O(C_{2}H_{4}O)_{20}H_{0}$$

14

$$CH_{2} = \begin{matrix} CH_{3} \\ I \\ -C - C - O(C_{2, 8}H_{5, 8}O)_{20}H \\ II \\ O \end{matrix}$$

$$CH_2 = CH - C - O(C_2H_4O)_{50}CH_3$$
 0

$$CH_{2} = C - C - O(C_{2}H_{4}O)_{50}H$$

$$0$$

【0014】共重合はベンゾイルバーオキサイド、ジク ミルバーオキサイド等の過酸化物類;アゾピスイソプチロニトリル等アゾ系化合物類等の、通常のラジカル重合 開始剤の存在下に行われ、溶液重合法、乳化重合法、懸濁重合法、塊状重合法の何れの方法を適用することも可能である。これらのうち、溶液重合法は得られる共重合物の分子量を最適範囲に調整することが容易であり、特に好ましい方法である。この場合に用いられる溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類;メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン類;酢酸エチル、酢酸イソブチルケトン等のケトン類;酢酸エチル、酢酸イソブチル等のエステル類等の一種又は二種以上の混合物が挙げられる。また、反応温度は50~180 ℃、特に60~120 ℃の範囲内で行うのが好ましく、この温度条件下であれば 5~10時間程度で反応を完結させることができる。

【0015】被覆組成物

本発明の被覆組成物としては、上述のようにして得られたグラフト共重合体溶液をそのまま使用してもよいし、グラフト共重合体を分離し別の溶剤に溶解してもよい。 該組成物には、必要に応じてその他の溶剤、架橋剤、上 記グラフト共重合体以外の樹脂、充填剤その他の各種添 加剤等を任意に組み合わせて添加することができる。溶

16

15

剤は組成物の粘度調整、被膜の膜厚調整等を目的として使用され、本発明のグラフト共重合体と相溶するものであれば特に制限はなく、例えばベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類; n - ヘキサン、 n - オクタン、 n - デカンなどの脂肪族炭化水素類; 塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素などの塩素系化合物類;メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン類; 酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル類; ジオキサン、 ジメチルフォルムアミドなどを例示することができる。これらは単独で使用 10 することも二種以上を組み合わせて用いることもできる。

【0016】本発明の被覆組成物は、前記グラフト共重 合体を溶剤に溶解するだけで良く、これによって優れた 常乾型塗料が得られる。共重合成分として、(メタ)ア クリル酸ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸ヒドロ キシプロピル、(メタ) アクリル酸ヒドロキシブチル等 のヒドロキシアルキルエステル類を使用した場合には、 更に架橋剤として多官能イソシアネート化合物を配合す ることにより、耐溶剤性に優れた被膜を得ることのでき 20 る常温硬化型塗料とすることも可能である。上記多官能 イソシアネート化合物は2官能以上のものであれば特に 制限はなく、例えばトリレンジイソシアネート(TD I)、ジフェニルメタンジイソシアネート(MDI)、 トリジンジイソシアネート(TODI)、ナフタリンジ イソシアネート(NDI)、ヘキサメチレンジイソシア ネート (HDI)、イソホロンジイソシアネート(IP DI)、キシリレンジイソシアネート(XDI)などの ジイソシアネート類;トリメチロールプロパン(TM P)、変性TDI、イソシアヌレート結合TDI、TM 30 P変性HDI、イソシアヌレート結合HDI、ビューレ ット結合HDI、TMP変性IPDI、イソシアヌレー ト結合IPDIなどのポリイソシアネート類が例示され る。イソシアネート化合物の配合量は本発明のグラフト 共重合体の水酸基1当量に対して 0.5~2.0 当量、特に 0.8~1.5 当量とすることが好ましい。また、この場合 架橋促進剤としてジプチル錫ジオクテート、ジブチル錫*

$$CH_{2} = C - C(CH_{2})_{3}Si(CH_{3})_{2}$$

$$||||$$

で表されるラジカル重合性基含有ジメチルポリシロキサン化合物35重量部、下記式;

【化14】

$$CH_{2} = C - C - O + C_{2}H_{4}O + C_{8}$$

$$CH_{2} = C - C - O + C_{2}H_{4}O + C_{8}$$

$$0$$

*ジラウレートなどの有機錫化合物を微量加えて架橋を促 進してもよい。

【0017】本発明の被覆組成物はグラフト共重合体を主成分とするものであるが、必要に応じてフェノール樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、アルキッド樹脂等の他の樹脂を配合しても良い。また、皮膜の強度向上を目的として、シリカ、アルミナ、ガラス粉、クレー、タルク、炭酸カルシウム、マイカ粉、二酸化チタン、ウォラストナイト、水酸化マグネシウム等の無機質充填剤を配合しても、その他の添加剤、例えば酸化防止剤、老化防止剤、帯電防止剤、着色剤等を配合しても良い。

【0018】<u>有用性</u>

本発明のグラフト共重合体を主成分とする被覆組成物 は、枝ポリマーの一つであるオルガノポリシロキサンが 塗膜表面に濃縮されるので、耐候性、撥水性、離型性、 潤滑性及び防汚性が発現する一方、ポリオキシアルキレ ンからなる枝ポリマーを含有することにより優れた帯電 防止性能を有する。更に、親水性のポリオキシアルキレ ンを含有しているにもかかわらず、従来のオルガノポリ シロキサンからなる枝ポリマーのみを含有するグラフト 共重合体よりも撥水性、潤滑性に優れている。これは、 本発明のグラフト共重合体には、オルガノポリシロキサ ンと相溶しないポリオキシアルキレンが存在することに より、オルガノポリシロキサンが途膜表面にいっそう濃 縮され易いからであると推定される。従って、本発明の グラフト共重合体を主成分とする被覆組成物は、感熱転 写記録用インクリボンの背面処理剤、磁気テープの背面 処理剤、建築用耐候性塗料、着氷・着雪防止塗料、貼り 紙・落書き防止塗料、海中生物付着防止塗料、コンクリ ート用防水塗料等に使用することができる。

[0019]

【化13】

【実施例】以下、本発明を実施例によって更に詳述する が、本発明はこれによって限定されるものではない。

【0020】 合成例1

ガラス製反応容器に、下記式;

で表されるラジカル重合性基含有ポリオキシアルキレン 化合物30重量部、メタクリル酸メチル28重量部、メタク リル酸ヒドロキシエチル 7重量部、メチルエチルケトン 75重量部、メチルイソプチルケトン75重量部及びアゾビ スイソプチロニトリル2重量部を仕込み、窒素気流中挽 拌しながら80~85℃で5時間共重合反応を行い、固形分 40重量%の粘稠な溶液を得た。更に、この溶液の固形分 50 換算の水酸基当量をJIS K 0070に従って測定したとこ



等開平5−230161

ろ、1880 g/molであった。次に、この溶液にメタノールを過量に加え、共重合体を沈降、洗浄する操作を3回行った後、100℃、10mmkgで減圧乾燥して無色透明固体状の共重合体を得た。得られた共重合体について、赤外線吸収スペクトル及び「HNMRスペクトルの分析を行った結果、ジメチルポリシロキサン及びポリオキシアルキレンがグラフトされた共重合体であることが確認された。また、GPCのよるポリスチレン換算の重量平均分*

17

*子量は約61,000であった。

【0021】合成例2~9

各合成例において、合成例1で使用したラジカル重合性 基合有ジメチルポリシロキサン化合物、ラジカル重合性 基合有ポリオキシアルキレン化合物、ラジカル重合性モ ノマー及び溶剤の代わりに、式(A);

(化15)

$$CH_{2} = C \\ C \\ C \\ C \\ OR^{2}Si(CH_{3})_{m}$$

$$- CH_{3} \\ CH_{3} \\ CH_{3} \\ CH_{3}$$

$$- CH_{3} \\ CH_{3} \\ CH_{3}$$

(式中、 R^1 、 R^2 、m及びn は表 1 に示す。)で表されるラジカル集合性基含有ジメチルポリシロキサン化合物、式(D);

【化16】

$$CH_{2} = \begin{matrix} R^{3} \\ I \\ C \\ C \\ -0 \\ C \\ 0 \end{matrix} + \begin{matrix} C_{1} & H_{2} & 0 \\ I & 0 \\ 0 \end{matrix} + \begin{matrix} R^{4} \\ R^{4} \end{matrix}$$

(式中、 R^3 、 R^4 、 i 及び j は表 1 に示す。)で表されるラジカル重合性基合有ポリオキシアルキレン化合物、表 1 に示すラジカル重合性モノマー及び溶剤を使用

したこと以外は合成例1と同様にして、グラフト共重合体溶液を得た。この溶液について、それぞれ合成例1と同様に固形分の濃度及び水酸基当量を測定した。更に、合成例1と同様に固体状の共重合体を得て、重量平均分子量を測定した。その結果を表2に示す。

20 【0022】なお、表1中のMMAはメタクリル酸メチル、BMAはメタクリル酸プチル、ZHEAはアクリル酸-2-エチルヘキシル、HEMAはメタクリル酸ヒドロキシエチル、PFMAはメタクリル酸パークロロオクチルエチル、MEKはメチルエチルケトン、MIBKはメチルイソプチルケトンを表す。

[0023]

【表1】

・カル共重合性基含有ジメチル ラジカル重合性基含有ポリ 他の共重合モノマー
リシロキサン化合物(A) オキシアルキレン化合物(D)
m n 重量部 R; K, k
(CH₂→, 2 50 35 CH₃ CH₃ 2
(CH ₂ →3, 2 50 35 CH3 CH3 2
{CH ₂ →3, 2 50 10 CH3 CH3 2
(Gh₂→s 2 50 10 GHs CHs 2
{CH₂→3 1 6 50 CH3 H 2.5
1 100 40 H C ₄ H ₈ 2
$\{GI_2 \rightarrow_1 \ 0 \ 12 \ 20 \ GI_1 \ H \ 2.8$
$(CH_2)_5$ 2 25 40 CH_5 2 2
$(\Theta_2 \rightarrow 3)$ 2 25 40

[0024]

【表2】

GPCによる重量 固形分の水酸基当量 固形分 平均分子量 (%) (g/mol) 61,000 1880 合成例1 40 77.800 1800 40 合成例2 41.900 合成例3 1850 40 156,000 1880 合成例 4 40 83, 500 1320 40 合成例 5 99, 200 2580 合成例 6 40 53, 100 930 40 合成例 7 122, 100 合成例8 40 58,600 40 合成例 9

【0025】実施例1

合成例 1 で得られたグラフト共重合体溶液をメチルエチルケトン/酢酸エチル(重量比 1:1)の混合溶剤で固形分が20重量%となるように希釈した。この希釈した溶液をアルミ板にスピナーで塗布して、24時間室温で風乾したところ、膜厚 $10\,\mu$ mの透明な被膜が得られた。この被膜について、下記の方法で、外観、水の接触角、動摩擦係数、耐候性、耐溶剤性及び帯電防止性を調べた。その結果を表3に示す。

[0026](1)外観:指で触り、ベタツキの有無を調べた。

ベタツキ無し … ○ ベタツキ有り … ×

(2) 水の接触角: 被膜に純水 5 μ1 を垂らし、コンタクト・アングル・メーター (Contact Angle Meter CA-A: 協和科学株式会社製) を用いて25℃で測定した。

(3) 助摩擦係数:表面性測定機 (EBIDON-14型: 親東科学株式会社製) を用いて下記の条件で測定した。

摩擦子: SUS Ball

荷重 : 20g

速度 : 150 mm/min

(4) 耐候性:サンシャインウェザーメーター (スガ試験機製) 中に1000時間暴露した後、光沢保持率を測定した。

光沢保持率が90%以上 ··· 〇 光沢保持率が90%未満 ··· ×

(5) 耐溶剤性:トルエンに1時間浸漬後、被膜を観察し

た。

変化なし … 〇

容解 … ×

(6) 帯電防止性: STATIC HONESTOMETER TYPE S-4104 (S HISHIDO CO., LTD.)を用いて下記の条件で耐電圧を測定 した。

印加電圧:10kV×30秒

電極距離:20㎜

[0027] <u>実施例2~8</u>

合成例1で得られたグラフト共重合体溶液の代わりに、 の 合成例2~8で得られた各グラフト共重合体溶液を用い た以外は実施例1と同様の操作を行い、被膜性能を調べ た。その結果を表3に示す。

【0028】比較例1

合成例1で得られたグラフト共重合体溶液の代わりに、 合成例9で得られたグラフト共重合体溶液を用いた以外 は実施例1と同様の操作を行い、被膜性能を調べた。そ の結果を表3に示す。

【0029】<u>実施例9</u>

合成例1で得られたグラフト共重合体溶液を、メチルエ 40 チルケトン/酢酸エチル (重量比1/1) の混合溶剤 で、固形分が20重量%になるように希釈した溶液100重量部にイソシアヌレート結合HDIを 2.7重量部及びジブチル錫ジオクテート0.05重量部を混合し、アルミ板にスピナーで塗布して3日間室温で風乾したところ、膜厚10μm の透明な被膜が得られた。この被膜について実施例1と同様に被膜性能を調べた。その結果を表3に示す。

【0030】 <u>実施例10</u>

合成例1で得られたグラフト共重合体溶液の代わりに、 50 合成例4で得られたグラフト共重合体溶液を使用した以

24

23

外は、実施例9と同様にして被膜を形成し、得られた被 膜について被膜性能を調べた。その結果を表3に示す。

* [0031] 【表3】

	グラフト 共重合体	外観	水の接触角 (度)	動摩擦 係数	耐候性	耐電圧(V)	耐溶剤性
実施例1	合成例 1	0	106	0. 058	0	0. 23	×
実施例 2	合成例 2	. 0	103	0.064	0	0. 35	×
実施例3	合成例3	0	100	0. 051	 O	0. 20	×
実施例 4	合成例 4	0	101	0.047	0	0. 11	×
実施例 5	合成例 5	0	98	0. 083	0	0. 38	×
実施例 6	合成例 6	0	106	0. 048	0	0. 29	×
実施例7	合成例7	0	. 105	0. 049	0	0. 39	×
実施例8	合成例8	0	104	0.060	0	0. 21	×
比較例1	合成例 9	0	95	0. 115	Ö	0. 75	· ×
実施例 9	合成例 1	0	105	0. 053	0	0. 20	0
実施例10	合成例 4	0	101	0. 048	0	0. 12	0

[0032]

【発明の効果】本発明のグラフト共重合体を主成分とす る被覆組成物は、耐候性、撥水性、防汚性、離型性、潤 滑性に優れているだけでなく、帯電防止性能にも優れて 30 ヒドロキシアルキルエステル類の共重合体を含む場合、 いる。更に、本発明のグラフト共重合体は枝ポリマーと して、オルガノポリシロキサンからなる枝ポリマーとポ リオキシアルキレンからなる枝ポリマーを有することか

ら、従来のオルガノポリシロキサンからなる枝ポリマー のみを有する共重合体よりも撥水性、潤滑性に優れてい る。また、本発明のグラフト共重合体は、幹ポリマーに このグラフト共重合体を主成分とする被覆組成物に多官 能イソシアネート化合物を配合すると耐溶剤性も向上さ せるこができる。

【手続補正書】

【提出日】平成4年4月21日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0002

【補正方法】変更

【補正内容】

[0002]

【従来の技術】ラジカル重合性基含有シリコーンマクロ モノマーを使用したシリコーン系グラフト共重合体は、 耐候性、撥水性、防汚性、離型性、潤滑性に優れている ことから、被覆材料として大きな関心が持たれている (特開昭58-154766号、特開昭59-20360 号、特開昭59 -126478号、特開昭61-151272号、特開昭62-156172 号)。然しながら、従来のシリコーン系グラフト共重合 体は、いずれも幹ポリマーがピニル系重合体、枝ポリマ ーがオルガノポリシロキサンのグラフト共重合体であ り、これを主成分とする被覆材料は、帯電防止性能に劣 るという欠点がある。